

# Осаждение нитрида кремния

**Si** подложка

или пробел для

продолжения

Все слайды

# Добавление слоя поликремния (Поли0)



Si подложка

или пробел для  
продолжения  
Все слайды

# Нанесение изображения через 1-ый уровень маски (Поли0), используя литографию

Структурированный фоторезист

**Si** подложка

или пробел для  
продолжения

Все слайды

# Удаление ненужного Поли0, используя реактивное ионное травление

**Si** подложка

или пробел для  
продолжения  
Все слайды

Осаждение 1-ого слоя оксида,  
используя LPCVD  
(химическое осаждение из газовой  
фазы при пониженном давлении)



или пробел для  
продолжения  
Все слайды

Нанесение изображения  
через маску 2-го уровня  
(углубление)  
используя фотолитографию...  
и глубинное реактивное  
ионное травление



или пробел для  
продолжения  
Все слайды

Нанесение изображения  
через маску 2-го уровня  
(углубление)  
используя фотолитографию...  
и глубинное реактивное  
ионное травление



МЫШКИ  
или пробел для  
продолжения  
Все слайды

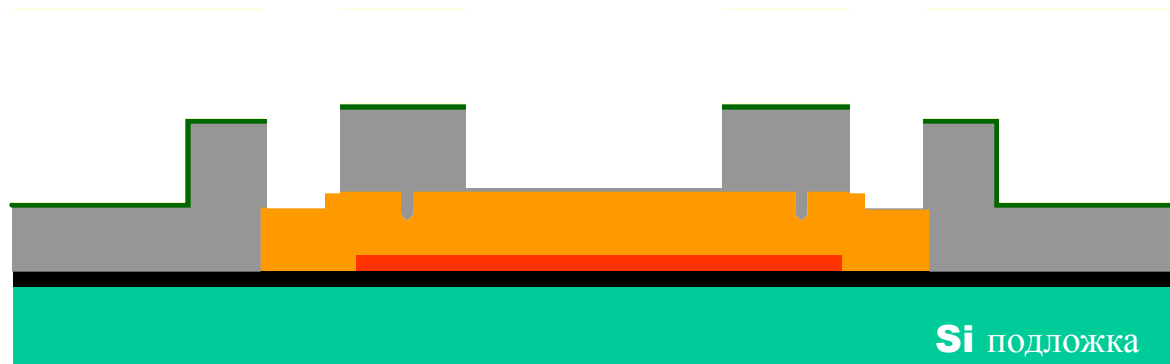
Нанесение безпримесного  
осаждённого слоя поликремния (Поли1)  
используя LPCVD...  
Затем осаждение PSG  
(фосфосиликатного стекла)  
и ОТЖИГ



или пробел для  
продолжения  
Все слайды

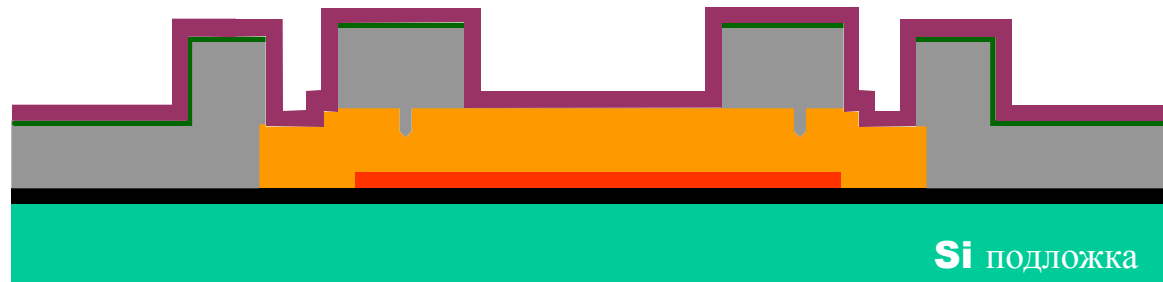


Нанесение изображения через  
4-й уровень маски (Поли1),  
используя фотолитографию...  
и глубинное реактивное  
ионное травление



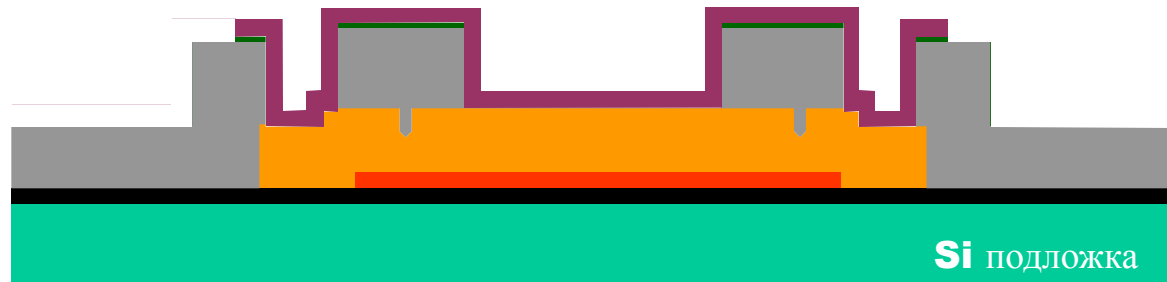
или пробел для  
продолжения  
Все слайды

# Осаждение 2-го слоя оксида



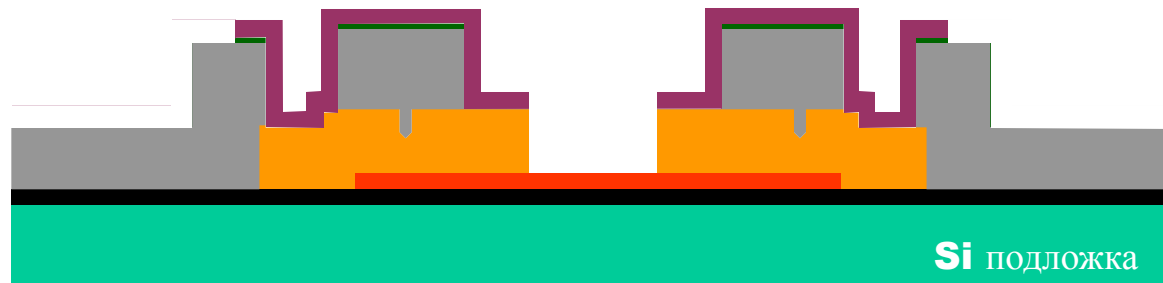
или пробел для  
продолжения  
Все слайды

Нанесение изображения через  
маску 5-го уровня, используя  
фотолитографию и  
глубинное реактивное  
ионное травление



или пробел для  
продолжения  
Все слайды

# Нанесение изображения через маску 6-го уровня, используя фотолитографию и глубинное реактивное ионное травление

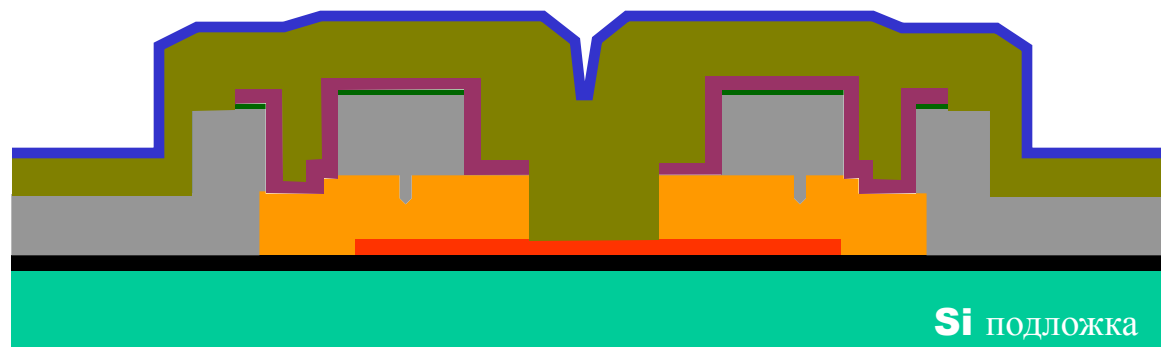


или пробел для

продолжения

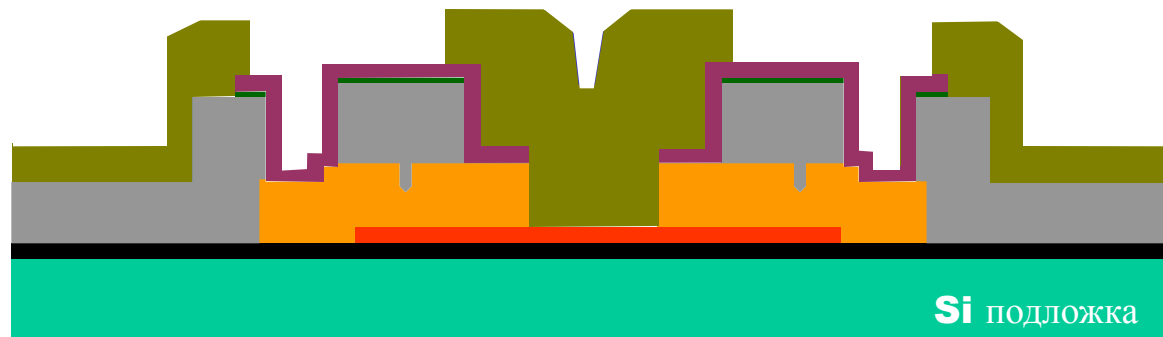
Все слайды

Осаждение безпримесного поликремния,  
затем нанесение PSG  
(фосфосиликатное стекло)  
слоя жёсткой маски,  
затем ОТЖИГ



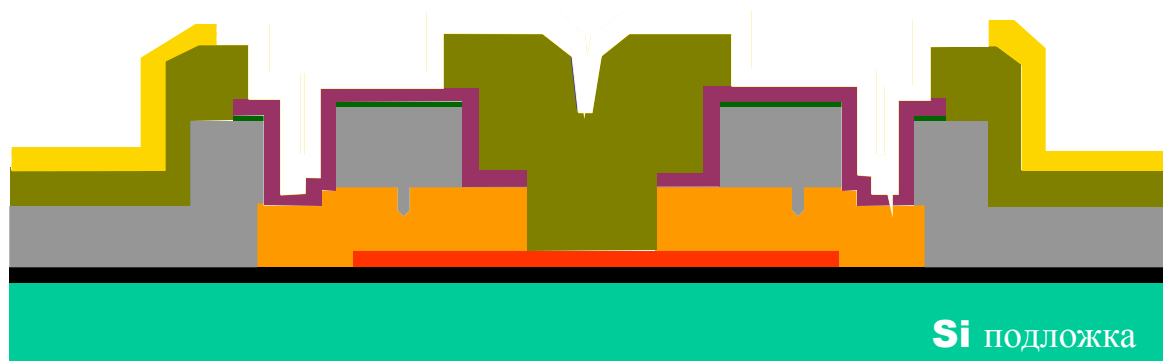
или пробел для  
продолжения  
Все слайды

Нанесение изображения через  
маску 7-го уровня, используя  
фотолитографию и  
глубинное реактивное  
ионное травление



или пробел для  
продолжения  
Все слайды

Нанесение изображения через маску 8-го уровня, используя фотолитографию и отрыв, затем удаление ненужного фоторезиста и металла в ванне растворителя



или пробел для  
продолжения  
Все слайды

# Реализация структуры, используя HF



или пробел для  
продолжения  
Все слайды